

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>  
C07D 213/42

(11) 공개번호 특1991-0007881  
(43) 공개일자 1991년05월30일

(21) 출원번호	특1990-0016854
(22) 출원일자	1990년 10월 22일
(30) 우선권주장	425713 1989년 10월 24일 미국(US)
(71) 출원인	헥스트-렛셀 파마슈티칼즈 인코포레이티드 제이 티. 웨크. 주니어
(72) 발명자	미합중국 뉴저지 08876 서머빌 루트 202-206 노스 리차드 찰스 알렌 미합중국 뉴저지 08822 플레밍톤 힐크레스트 로오드 알디3 박스 514 조셉 토마스 클레인 미합중국 뉴저지 08807 브리지워터 루트 202-206노스 1075 리차드 찰스 에플랜드 미합중국 뉴저지 08807 브리지워터 롤링 힐스 로오드 544
(74) 대리인	이병호, 최달용

심사청구 : 없음

(54) 아미노피리디닐아미노페놀 및 관련화합물, 이들의 제조방법 및 중간체 및 약제로서의 이들의 용도

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

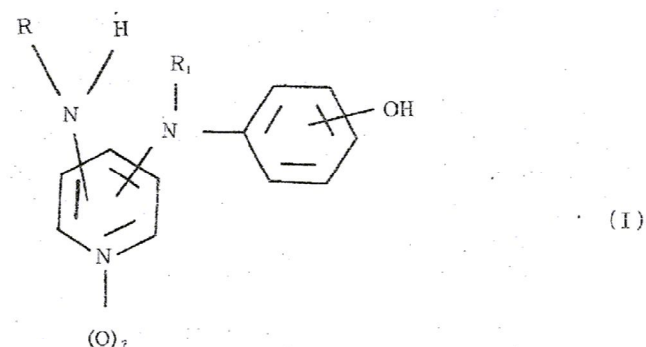
아미노피리디닐아미노페놀 및 관련화합물, 이들의 제조방법 및 중간체 및 약제로서의 이들의 용도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

일반식(I)의 화합물 또는 이의 약제학적으로 허용되는 산 부가염.



상기식에서 R은 수소, 저급알킬, 아릴저급알킬 저급알킬카보닐이고 R<sub>1</sub>은 수소, 저급알킬 또는 저급알킬카보닐이고 n은 0또는 1이다.

청구항 2

제1항에 있어서, R 및 R<sub>1</sub>이 수소이고, n이 0인 화합물.

청구항 3

제2항에 있어서, 3- [(4-아미노-3-피리디닐)아미노] 페놀인 화합물.

#### 청구항 4

제2항에 있어서, 4-(4-아미노-3-피리디닐)아미노] 페놀인 화합물.

#### 청구항 5

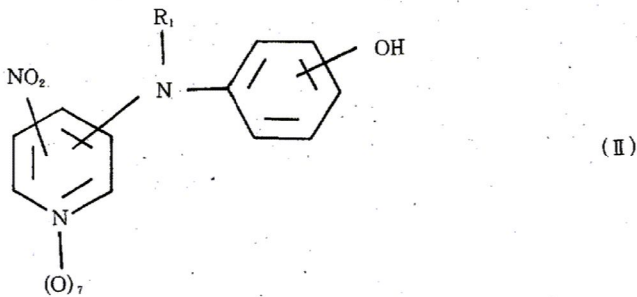
피부 질환치료 유효량의 제1항에 따른 화합물 및 이를 위한 적절한 담체를 함유하는 피부학적 조성물.

#### 청구항 6

피부병 치료에 유용한 약제의 제조를 위한 제1항에 따른 화합물의 용도.

#### 청구항 7

일반식(II)의 화합물 또는 이의 약제학적으로 허용되는 산 부가염.



상기식에서 n은 0 또는 1이고: R<sub>1</sub>은 수소, 저급알킬 또는 저급알킬카보닐이다

#### 청구항 8

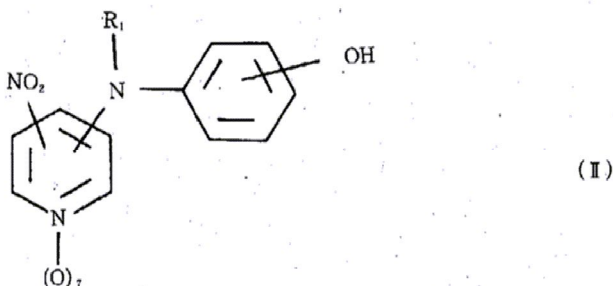
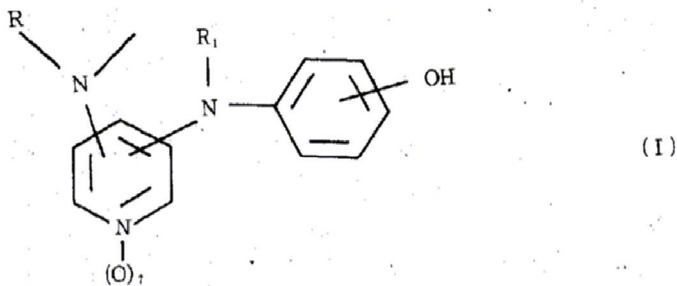
제7항에 있어서, R<sub>1</sub>이 수소인 화합물.

#### 청구항 9

피부질환 치료 유효량의 제7항에 따른 화합물, 및 이의 적절한 담체를 포괄하는 피부학적 조성물.

#### 청구항 10

a)일반식(II)(여기에서, R<sub>1</sub> 및 n은 상기에서 정의)의 화합물을 촉매적으로 수소화시켜 일반식(I)의 화합물(여기에서, R<sub>1</sub> 및 n은 앞서 정의한 것이고 R은 수소이다)을 수득하고 b)수득한 화합물과 일반식 R-Hal(여기서는 R은 저급알킬, 아릴저급알킬 또는 저급알킬 카보닐이다)의 화합물과 임의로 반응시켜 일반식(I)의 화합물(여기에서 R<sub>1</sub> 및 n은 이미 정의한 것이고 R은 상기에서 정의한다)을 수득하는 것을 포함하는 제1항에 따른 일반식(I)의 화합물 제조방법.



※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

